

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 10 月 3 日(03.10.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/146733 A1

- (51) 国際特許分類:
C08J 5/14 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 37/24 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/058690
- (22) 国際出願日: 2013 年 3 月 26 日(26.03.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-070037 2012 年 3 月 26 日(26.03.2012) JP
- (71) 出願人: 富士紡ホールディングス株式会社
(FUJIBO HOLDINGS, INC.) [JP/JP]; 〒1030013 東京都中央区日本橋人形町 1 丁目 1 8 番 1 2 号
Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 立野 哲平(TATENO Teppei); 〒7991342 愛媛県西条市大新田 2 7 2 フジボウ愛媛株式
会社内 Ehime (JP). 宮坂 博仁(MIYASAKA Hiro-
hito); 〒7991342 愛媛県西条市大新田 2 7 2 フ
ジボウ愛媛株式会社内 Ehime (JP). 松岡 立馬
(MATSUOKA Tatsuma); 〒7991342 愛媛県西条市大
新田 2 7 2 フジボウ愛媛株式会社内 Ehime
(JP). 金澤 香枝(KANAZAWA Kae); 〒7991342 愛

媛県西条市大新田 2 7 2 フジボウ愛媛株式会
社内 Ehime (JP). 宮澤 文雄(MIYAZAWA Fumio);
〒4101394 静岡県駿東郡小山町小山 4 7 富士
紡ホールディングス株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 辻居 幸一, 外(TSUJII Koichi et al.); 〒
1008355 東京都千代田区丸の内 3 丁目 3 番 1 号
新東京ビル 中村合同特許法律事務所 Tokyo
(JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

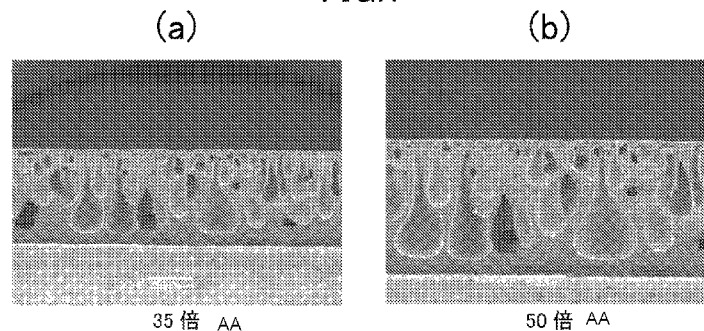
[続葉有]

(54) Title: POLISHING PAD AND METHOD FOR PRODUCING POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド及び研磨パッドの製造方法

[図1]

FIG.1



AA 35×, 50×

(57) Abstract: A method for producing a polishing pad having a polyurethane resin film as a polishing layer on a film substrate, the method comprising: a step in which a polyurethane resin film-forming composition containing a polyurethane resin and an additive is dissolved in a solvent in which the resin can be dissolved; a step for removing an insoluble component in the solution so that the insoluble component reaches less than 1 mass% in relation to the total mass of the polyurethane resin film-forming composition; a step for adding and mixing a poor solvent into the solution from which the insoluble component has been removed, in an amount (in mL) calculated by the formula (1): "Coagulation value of the polyurethane resin in the poor solvent (in mL) × A" (where A = 0.007 to 0.027) per gram by mass of the solid content of the resin; and a step for forming a film of the mixed solution on a film-forming substrate by wet coagulation to produce the polyurethane resin film. Provided thereby are a method for producing a finishing polish-ing pad and a polishing pad which enable polishing with fewer polishing defects and make it possible to form a stable film.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2013/146733 A1



(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

ポリウレタン樹脂及び添加剤を含むポリウレタン樹脂フィルム形成用組成物を、前記樹脂の可溶性溶媒に溶解する工程、前記溶液中の不溶成分が、ポリウレタン樹脂フィルム形成用組成物の全質量に対して1質量%未満となるように不溶成分を除去する工程、前記不溶成分を除去した溶液に、樹脂の固形分質量1gに対して、貧溶媒を、式1：ポリウレタン樹脂の前記貧溶媒に対する凝固価(m l) × A (A = 0.007 ~ 0.027)により計算される量(m l)において添加し、混合する工程、前記混合溶液を湿式凝固法により成膜基材上で成膜させてポリウレタン樹脂フィルムを作成する工程、を含む膜基材上にポリウレタン樹脂フィルムを研磨層として有する研磨パッドの製造方法により、研磨傷の少ない研磨を可能とし、かつ安定な膜を形成することができる仕上げ用研磨パッドの製造方法及び研磨パッドを提供する。